

財團法人國家實驗研究院 公告

發文日期：中華民國115年8月25日

發文字號：國研授半導體蝕字第1151301177號

附件：

主旨：本院台灣半導體研究中心(以下簡稱本中心) FSE Cluster
PVD-多層金屬濺鍍系統暫停使用公告

公告事項：

- 一、本中心FSE Cluster PVD-多層金屬濺鍍系統，因使設備進行改善工程，目前已委外請廠商進行檢測與改善施工。
- 二、故115年9月1日至9月4日暫停相關製程服務，若有提前或延後時程，將公告於本中心網頁機台狀況。
- 三、原委託代工服務將暫時轉移至CT-T29 8吋金屬物理氣相沉積系統(8吋PVD)，使用者如果有任何問題，可洽機台負責人工程師王興祥 分機7549，進行後續製程安排。

院長 蔡長策

授權單位主管決行